

■安定同位体ガス一覧

ガス種	純度	充填量	分野	用途及び目的
D ₂ (重水素)	99.75 atom% 99.999%	7,300 L	[半 導 体] [光ファイバー] [原 子 力] [分 析]	1.用途 ・アニール工程 ・重水素パッシベーション工程 2.使用目的 ・微細半導体の熱影響の最小化 ・p-type CMOS・nMOS回路、LED、レーザーダイオードの製造 ・水素パッシベーションの代替 1.用途 ・water peak除去工程 2.目的 ・透過率向上 1.低温核融合の雰囲気ガス 1.NMR分析用標準試薬の製造
He-3 (ヘリウム3)	>99.9 atom% 99.999%	1 L 100 L		1.用途 ・中性子検出器 ・分光計 ・イメージ画像 ・リングレーザー ・希釈冷凍機 ・極低温物理研究
11BF ₃ (三フッ化ホウ素)	99.9 atom% 99.99%	400 g	[半 導 体]	1.用途 ・フラッシュメモリー製造 ・液晶パネル製造 ・太陽光電池製造 2.使用目的 ・CVD工程におけるp-type ドーパント
18O ₂ (酸素同位体)	>97 atom% >99.9%	50 L	[半 導 体]	1.用途 ・次世代酸化膜半導体製造工程 ・植物生物学、金属工学の分子トレース
Ne-20 (ネオン20)	99.9%	20 L	[医療PET]	1.用途 ・リングレーザージャイロ(誘導システム)
Xe-129 (キセノン129)	>85 atom% 99.999%	10 L	[医療MRI]	1.用途 ・イメージ画像(肺、脳の血管造影に有効)
研究用 混合ガス	Xe-129 1% N ₂ (5N) 10% He(5N) Blance	6,700 L		